ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА, 2019, том 38, № 10, с. 22–25

____ СТРОЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, КВАНТОВАЯ ХИМИЯ, СПЕКТРОСКОПИЯ

УДК 543.424.2

СТРОЕНИЕ ФОТОПОЛИМЕРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, ПО ДАННЫМ МЕТОДА СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ

© 2019 г. А. В. Павликов^{1, 2, 3*}, Е. А. Константинова^{1, 2, 3, 4}, И. Г. Калинина⁵, С. М. Шебанов⁶

¹Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия ²Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений, Москва, Россия ³Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия ⁴Московский физико-технический институт (университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия ⁵Институт химической физики имени Н.Н. Семёнова Российской академии наук, Москва, Россия ⁶ЗАО "ЛЭКИС" (Лаборатория экспериментальных исследований), Москва, Россия *E-mail: pavlikov@physics.msu.ru

Поступила в редакцию 20.03.2019; после доработки 24.04.2019; принята в печать 20.05.2019

Методом спектроскопии комбинационного рассеяния света проведено исследование промышленного фотополимера, используемого в принтерах трехмерной печати. Установлено, что в спектре комбинационного рассеяния света изделия аддитивного производства отсутствуют линии при 1405 и 2992 см⁻¹, соответствующие деформационным и валентным колебаниям в С–Н-связях, которые присутствуют в спектре исходного жидкого фотополимера. Данный эффект свидетельствует об изменении колебательного спектра после процесса полимеризации. Полученная информация может быть полезна для разработки технологических покрытий на основе полученных образцов.

Ключевые слова: аддитивные технологии, фотополимеры, 3D-печать, комбинационное рассеяние света.

DOI: 10.1134/S0207401X1910008X

введение

В последние годы наблюдается рост публикаций, посвященных описанию основных принципов аллитивных технологий и изучению материалов, полученных с их помощью [1-3]. Аддитивные технологии — это технологии послойного создания спроектированного объекта из различных материалов. При послойном нанесении материала с помощью трехмерной (3D) печати могут использоваться такие материалы, как дерево и металл [2]. Возможно нанесение тонких покрытий методами молекулярно-лучевой эпитаксии [4], осаждением из газовой фазы [5], термическим и магнетронным распылением [6]. При этом спектр используемых материалов существенно увеличивается. Указанные метолы позволяют наносить не только тонкие покрытия (толщиной от единиц нанометров и более), но и полупроводниковые, диэлектрические.

Последние годы наибольшую популярность приобрели методы 3D-печати пластиками [7]. Данный способ печати, также являющийся одной из разновидностей аддитивных технологий, за-

ключается в послойном нанесении жидкого вещества, застывающего на поверхности.

Влияние ультрафиолетового лазерного излучения [8] и многофотонного поглощения фемтосекундного излучения [9] на процессы полимеризации изучались методом оптического поглощения и отражения. Исследование спектроскопическими методами процессов полимеризации нанесенных покрытий зачастую имеет немаловажную практическую [10] и научную ценность [11]. Поэтому для определения толщины и пористости покрытий, их химического состава используются методы ИК-спектроскопии [10–13] и комбинационного рассеяния света (КРС) [13–15].

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В данной работе исследовались исходная фотополимерная смола Formlabs Tough v1 Resin и изделие, полученное на принтере Formlabs Form 2, работающем по принципу лазерной стереолитографии (SLA). Для полимеризации в этом методе используется ультрафиолетовый лазер.



Рис. 1. Спектр КРС исходного жидкого фотополимера (*1*) и поверхности изделия (*2*), полученного из него, методом 3D-печати; $v_1 = 1405 \text{ см}^{-1}$ и $v_2 = 2992 \text{ см}^{-1}$.

Регистрация спектров КРС проводилась на микрораманоской установке Horiba Jobin Yvon HR800 в геометрии обратного рассеяния с использованием 10- и 50-кратных объективов. Источником возбуждения служил гелий-неоновый лазер ($\lambda = 633$ нм) мощностью W = 10 мВт.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

На рис. 1 представлен спектр КРС исходного фотополимера и поверхности изделия, полученного из него методом 3D-печати. Спектры представлены с вычетом фона, но без нормировки.

В спектрах КРС как исходного образца, так и готового аддитивного изделия присутствует широкая полоса рассеяния в области 2800—3050 см⁻¹, имеющая сложную составную форму. В этой полосе можно выделить отдельные пики с максимумами при 2880, 2928 и 2958 см⁻¹. Положение максимумов этих пиков определено благодаря выполненному разложению спектра КРС на составляющие в компьютерном приложении.

На рис. 2 представлен результат моделирования спектра фотополимера в области 2700–3100 см⁻¹. Эта область соответствует валентным колебаниям С–Н-связей [15, 16]. Линия *1* имеет максимум при 2893 см⁻¹ и соответствует вкладу симметричных валентных колебаний; линия *2* имеет максимум при 2928 см⁻¹ и соответствует вкладу ассимметричных валентных колебаний. Линия *3* имеет максимум при 2958 см⁻¹ и аналогично предыдущему пику приписывается вкладу ассиметричных валентных колебаний. Четвертый пик при 2992 см⁻¹, согласно литературным данным [17], также следует связывать с ассиметричными валентными С–Н-колебаниями эпоксидной группы. Для сравнения было выполнено разложение участка спектра КРС изделия аддитивного производства на отдельные составляющие, которое представлено на рис. 3. В этом разложении можно говорить о наличии только трех пиков с максимумами при 2882, 2928 и 2958 см⁻¹. Два последних значения в точности совпадают с теми, что присутствуют в спектре исходного фотополимера, первое – несколько смещено в сторону меньших волновых чисел, а четвертое отсутствует.

Результат разложения спектра исходного жидкого фотополимера в области от 300 до 1800 см⁻¹ представлен на рис. 4. Интенсивность сигнала слабее, о чем можно судить по отношению сигнал/шум, но тем не менее можно выделить более 15 линий. Волновые числа, соответствующие максимумам линий, следующие: 370, 450, 604, 758, 857, 885, 970, 1057, 1124, 1254, 1297, 1396, 1405, 1454, 1640, 1722 см⁻¹. Из рис. 4 видно, что огибающая указанных пиков дает хорошее совпадение с экспериментом.

В состав фотополимеров может входить акрил, полиизопрен, полиамиды, эпоксидные смолы, полиимиды, стирольные блок-сополимеры. Валентные колебания двойной С=О-связи в акрилах дают пики при 1716 см⁻¹, а в амидах — при 1639 см⁻¹ [15, 16]. Пики в районе 1454 и 1722 см⁻¹ связаны с симметричными и ассиметричными С–О–С-колебаниями. Еще одна интенсивная линия при 604 см⁻¹ может быть связана с деформационными колебаниями С–H-связей [15, 16].

Обсудим происхождение линии с максимумом при $v_1 = 1405 \text{ см}^{-1}$. Согласно литературным данным [18], в спектрах углеводородов полоса деформационных колебаний CH₂ находится в области 1480—1440 см⁻¹, но в присутствии соседних нитрильных, нитро- или карбонильных групп эта по-



Рис. 2. Результат разложения спектра КРС исходного жидкого фотополимера в области от 2700 до 3100 см⁻¹ (подробнее см. в тексте).



Рис. 3. Результат разложения спектра КРС изделия аддитивного производства в области от 2700 до 3100 см $^{-1}$; обозначения те же что и на рис. 2 (см. текст).



Рис. 4. Сравнение экспериментального спектра КРС фотополимера (1) и огибающей пиков разложения (2) в области от 300 до 1800 см^{-1} ; $v_1 = 1405 \text{ см}^{-1}$.

лоса детектируется при 1405—1450 см⁻¹. Сравнение спектров исходного фотополимера и изделия, полученного на 3D-принтере, позволяет сделать вывод о том, что главное различие состоит в отсутствии двух линий в спектре изделия: это линии при $v_1 = 1405$ см⁻¹ и $v_2 = 2992$ см⁻¹ (см. рис. 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установленный эффект свидетельствует об изменении колебательного спектра после процесса полимеризации, что, в свою очередь, обусловлено перестройкой химических связей в образце аддитивной технологии по сравнению с исходным материалом. Полученная информация важна как с фундаментальной точки зрения изучения колебательных спектров новых материалов, так и с практической, поскольку процесс полимеризации существенно влияет на механические свойства образцов и очень важно иметь метод независимого контроля данного процесса.

Исследования были выполнены на оборудовании ЦКП Физического факультета МГУ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках выполнения соглашения № 14.625.21.0041 от 26.09.17 (уникальный идентификатор RFMEFI62517X0041).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Tofail S.A.M., Koumoulos E.P., Bandyopadhyay A. et al. // Mater. Today. 2018. V. 21. Issue 1. P. 22.
- 2. Кузнецов П.А., Васильева О.В., Теленков А.И., Савин В.И., Бобырь В.В. // Новости материаловедения. Наука и техника. 2015. № 2. С. 4.
- Шеховцов А.А., Карпова Н.П. // Научно-методический электронный журнал "Концепт". 2015. Т. 13. С. 141.

- Cho A. Y., Arthur J.R. // Prog. Solid State Chem. 1975. V. 10. Pt. 3. P. 157.
- Asatekin A., Barr M.C., Baxamusa S.H. et al. // Mater. Today. 2010. V. 13. Issue 5. P. 26.
- Ishii K. // J. Vac. Sci. Technol., A. 1989. V. 7. № 2. P. 256.
- Leonards H., Engelhardt S., Hoffmann A. et al. // Proc. SPIE. 2015. V. 9353; https://doi.org/10.1117/12.2081169
- 8. Западинский Б.А., Котова А.В., Матвеева И.А. и др. // Хим. физика. 2010. Т. 29. № 10. С. 87.
- 9. Залесский А.Д., Данильченко Н.А., Барбашов Ю.В. и др. // Хим. физика. 2012. Т. 31. № 6. С. 3.
- 10. Norman H. Tennent, Joost Caen, Patrick Courtney, Enrique Lozano Di // e-PS. 2009. V. 6. P. 107.
- 11. Любимова Г.В., Шашкова В.Т., Любимов А.В., Западинский Б.И. // Хим. физика. 2010. Т. 29. № 4. С. 84.
- Luís Eduardo Silva Soares, Rick Rocha e Airton Abrahão Martin, Antonio L.B. Pinheiro, Marcelo Zampieri // Quim. Nova. 2005. V. 28. № 2. P. 229.
- Pavlikov A.V., Gayduchenko I.A., Mussabek G.K. et al. // J. Nanoelectron. Optoelectron. 2012. V. 7. № 6. P. 629.
- 14. *Merad L., Cochez M., Margueron S. et al.* // Polym. Testing. 2009. V. 28. Issue 1. P. 42.
- Larkin P. // Chapter 7 General Outline and Strategies for IR and Raman Spectral Interpretation. Infrared and Raman Spectroscopy. Elsevier, 2011. P. 117.
- Diem M. Modern Vibrational Spectroscopy and Micro-Spectroscopy: Theory, Instrumentation and Biomedical Applications. First Ed. John Wiley & Sons, Ltd., 2015.
- 17. *Hachuła B., Nowak M., Kusz J. //* Chem. Crystallogr. 2010. V. 40. P. 201.
- Socrates G. Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies. Tables and Charts. Third Ed. John Wiley & Sons, Ltd. 2001.